

Abstract

被処理基板を保持して回転させる基板保持ローラと、前記非処理基板のエッジ部に接触し、少なくとも前記被処理基板に接触する部分にフッ素系樹脂粒子を含む樹脂材料からなるエッジ洗浄部と、を備える基板洗浄装置が提供される。

Figure 5